

Mesures des propriétés thermiques d'assemblages en couches minces à haute température

Jean-Luc Battaglia

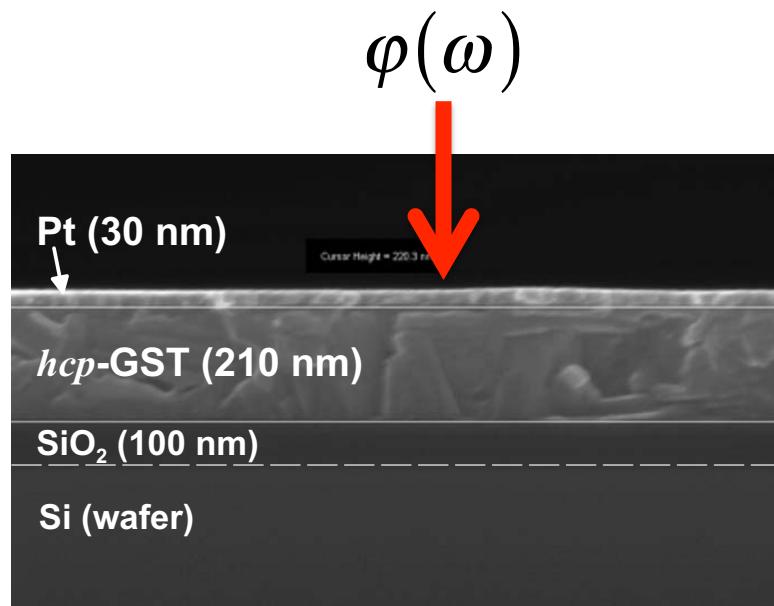
13/02/2014

Quelques illustrations sur des travaux récents

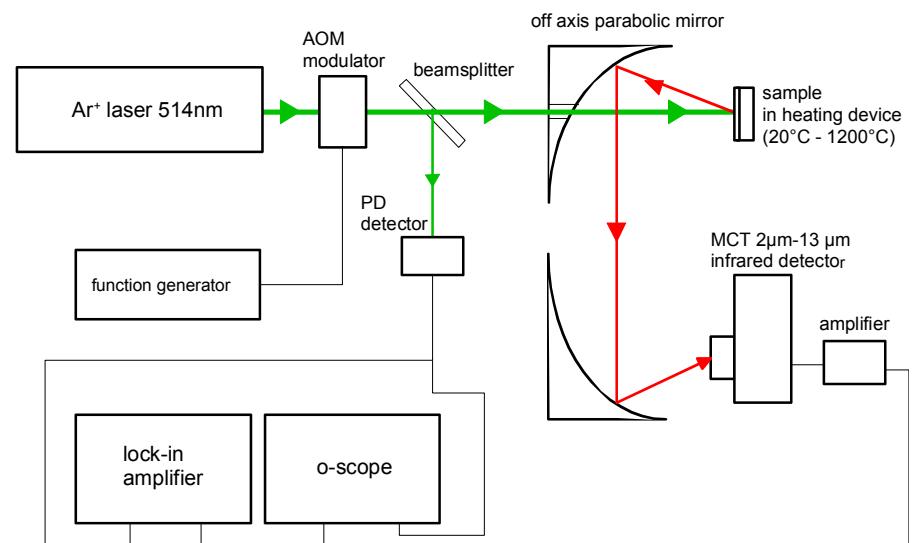
- Mesures des propriétés thermiques de matériaux à changement de phase pour la micro-électronique
- Mesures des propriétés thermiques de couches minces diélectriques en phase solide et liquide
- Mesure de la conductivité de matériaux pour le nucléaire
- Mesure de la conductivité thermique de films de diamant déposés par plasma assisté par laser

Mesures des propriétés thermiques de matériaux à changement de phase pour la micro-électronique

J.-L. Battaglia, A. Kusiak, V. Shick, A. Cappella, C. Wiemer, M. Longo, E. Varesi, *Thermal characterization of the SiO_2 - $Ge_2Sb_2Te_5$ interface from the ambient up to 400°C*, J. Appl. Phys. **107**, 044314 (2010).



Radiométrie photothermique modulée



Difficultés inhérentes à la mesure à haute température

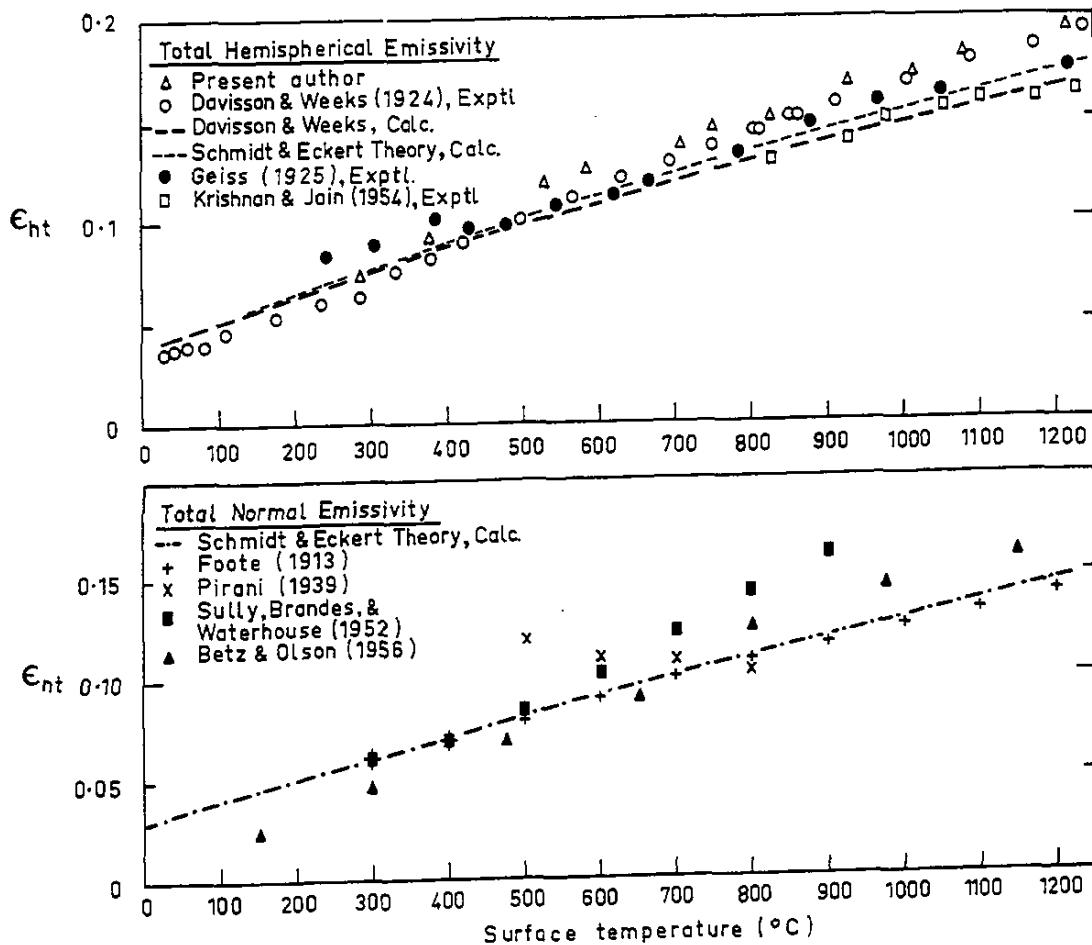
- La couche métallique supérieure joue le rôle de transducteur optique (métal, émissivité faible) et thermique (fréquence faible < 1MHz);
- Elle joue un rôle vis à vis de l'oxydation et de l'évaporation du matériau à caractériser;
- Elle évite le rayonnement à I_g dans le cas des SC;
- Elle doit rester intègre aux températures élevées à pression atmosphérique, sa température de fusion doit être grande devant la température maximale exploré (risque d'évaporation sur la fenêtre du four, surtout à basse pression).

Les solutions trouvées

- Plusieurs types de couches métalliques ont été testées; le Pt ($T_f = 1840$ K) est celle qui a donné les meilleurs résultats;
- Il vaut mieux travailler sous atmosphère contrôlée que sous vide (fréquence d'excitation suffisamment élevée pour négliger les pertes, moins de risque d'évaporation de la couche métallique à température élevée).

Emissivité du Pt en fonction de T

Application of hemispherical surface pyrometers to the measurement of the emissivity of platinum (a low-emissivity material)



P. R. C. GOARD
Division of Coal Research, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization,
Chatswood, N.S.W., Australia
MS. received 29th November 1965

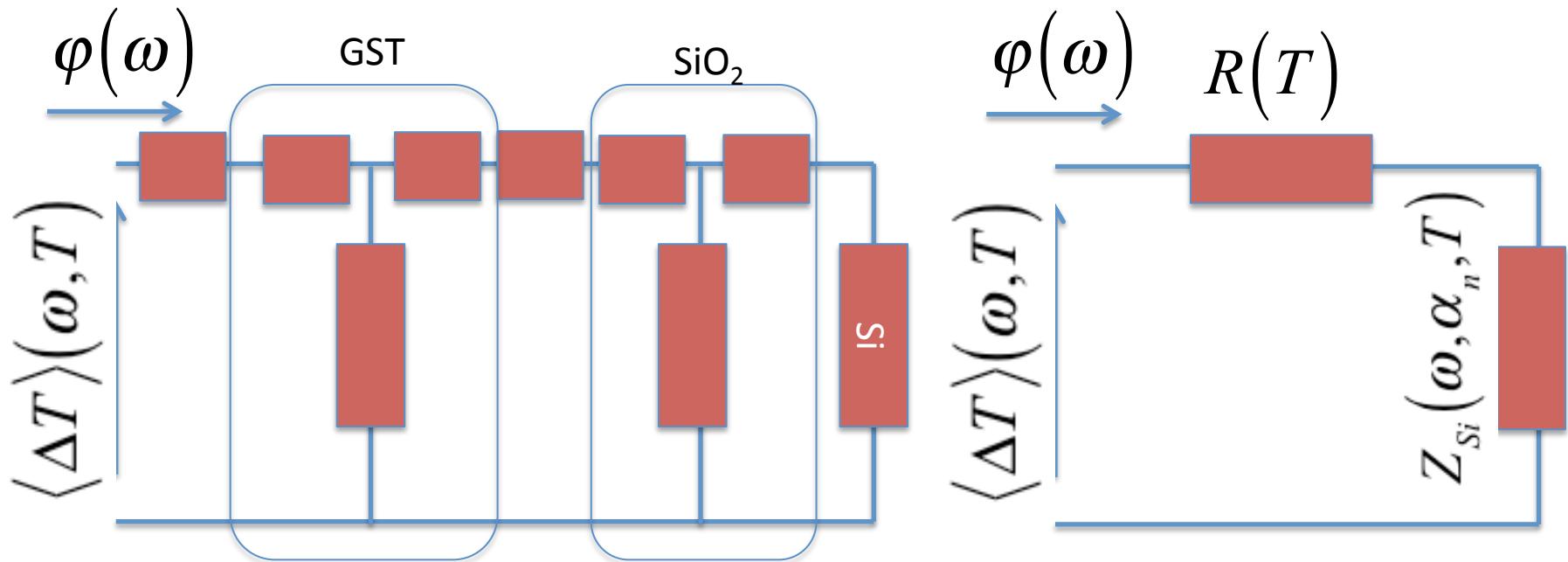
Modèle

$\omega = 2\pi f$ tel que

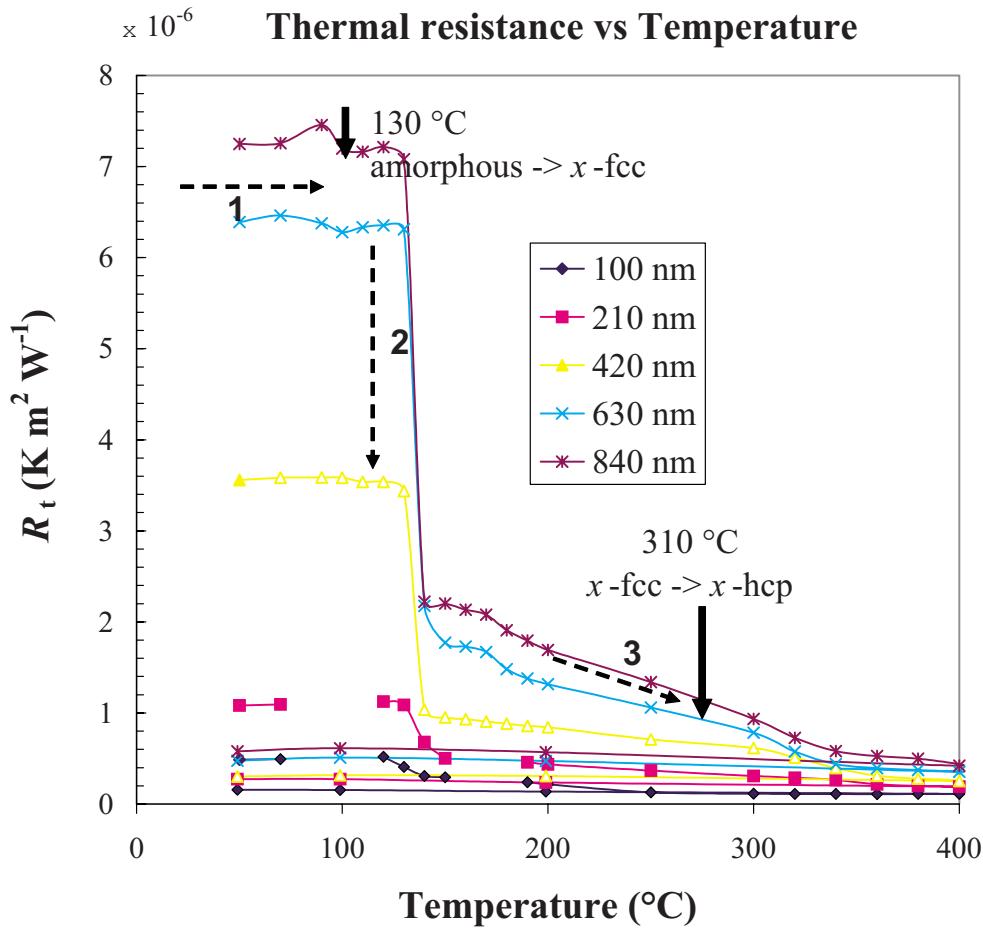
$$e_d \gg \sqrt{\alpha_? / \pi f}$$

$\omega = 2\pi f$ tel que

$$e_d \ll \sqrt{\alpha_? / \pi f}$$



Mesures de résistance thermique du dépôt

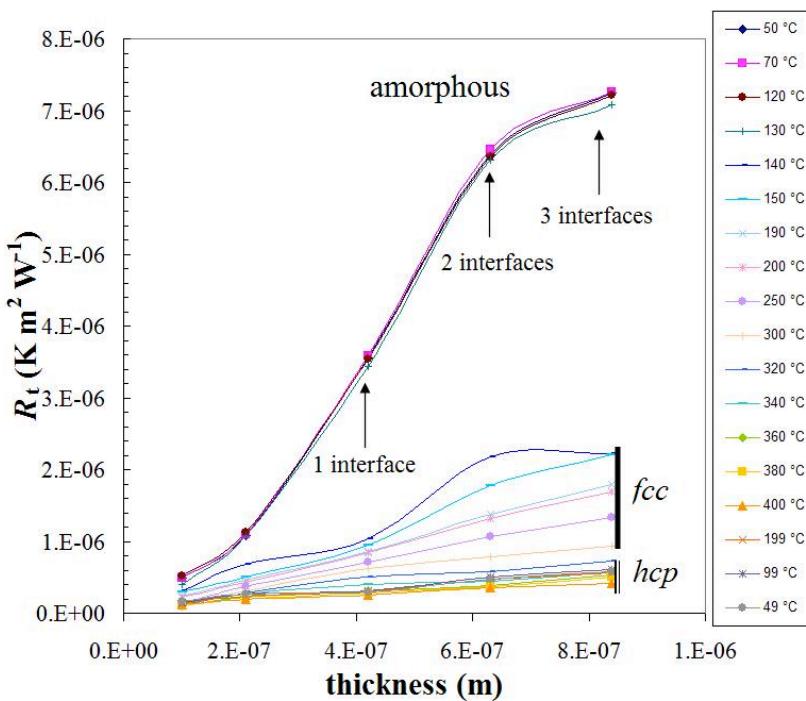


$$R(T) = \frac{e_{\text{GST}}}{k_{\text{GST}}(T)} + R_i(T) + \frac{e_{\text{SiO}_2}}{k_{\text{SiO}_2}(T)}$$
$$R_t(T)$$

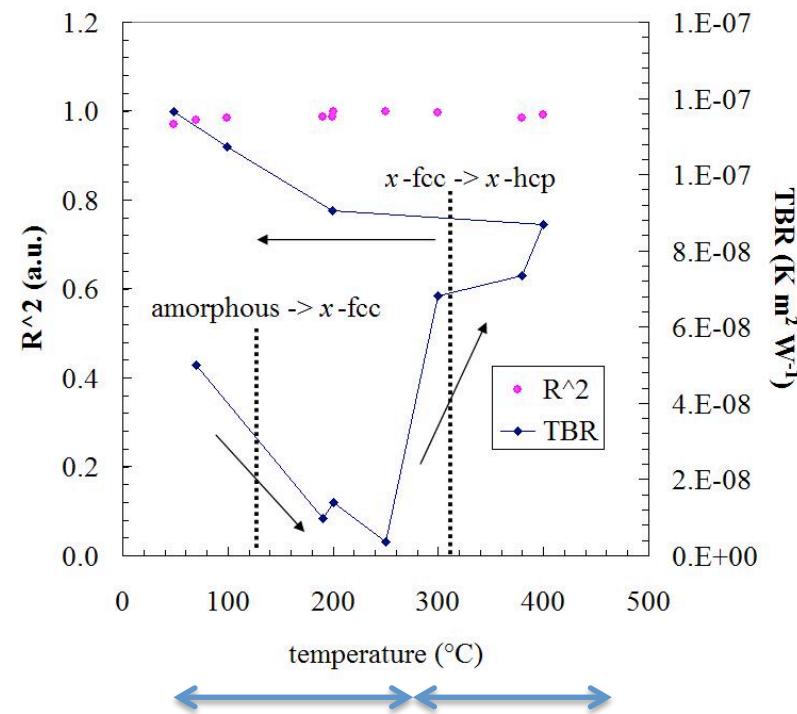
R est identifié à partir de la mesure de phase

Influences des interfaces

Thermal resistance vs GST thickness



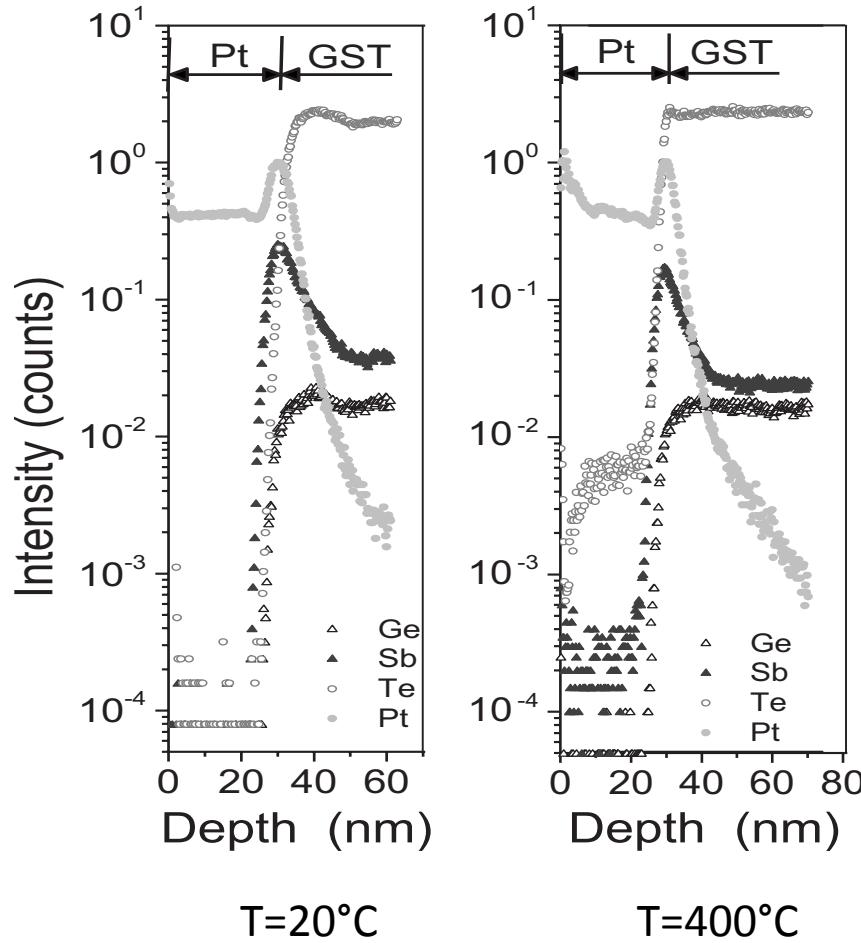
TBR vs T



Compatible
avec modèle
Phonon-phonon

Diffusion de
masse

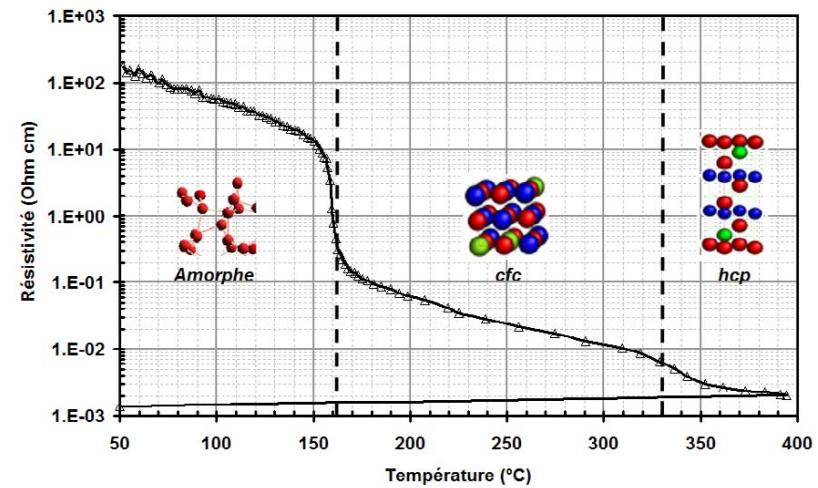
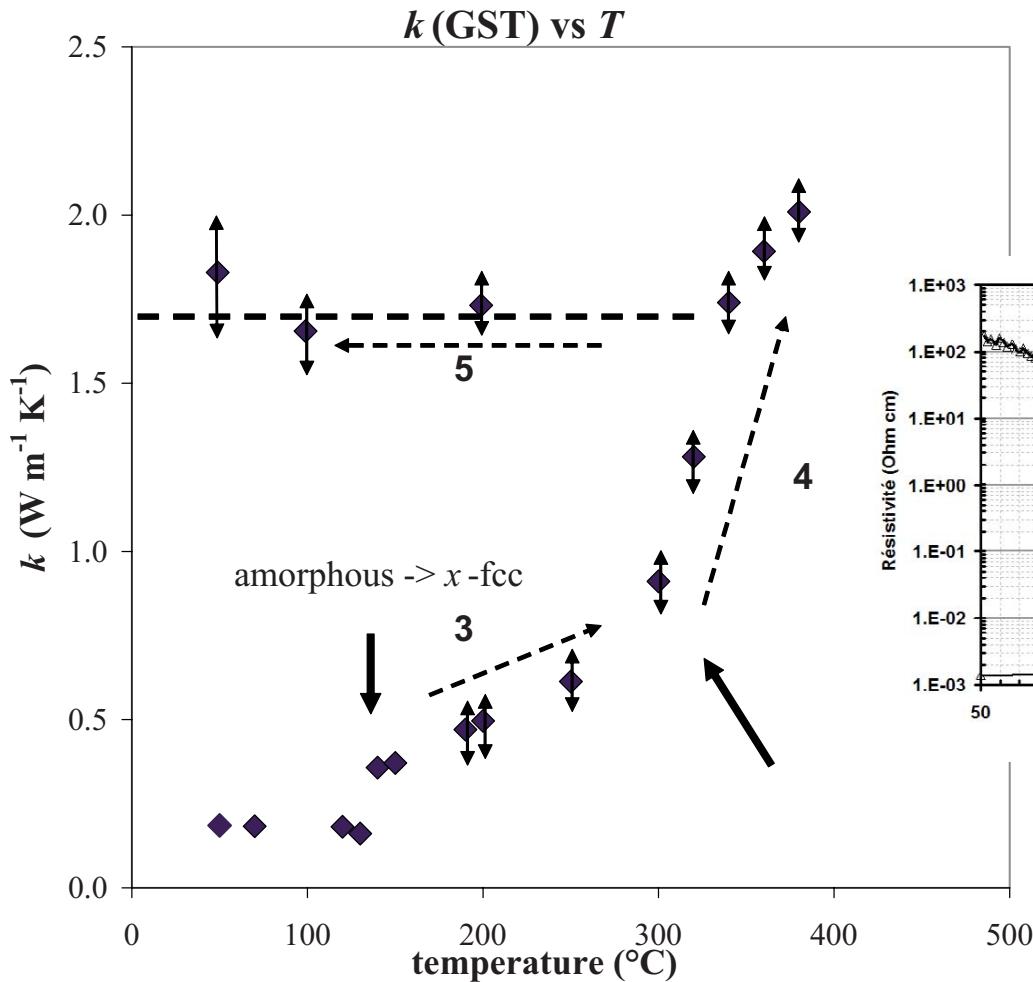
Caractérisation physico-chimique



Mesure Tof-SIMS

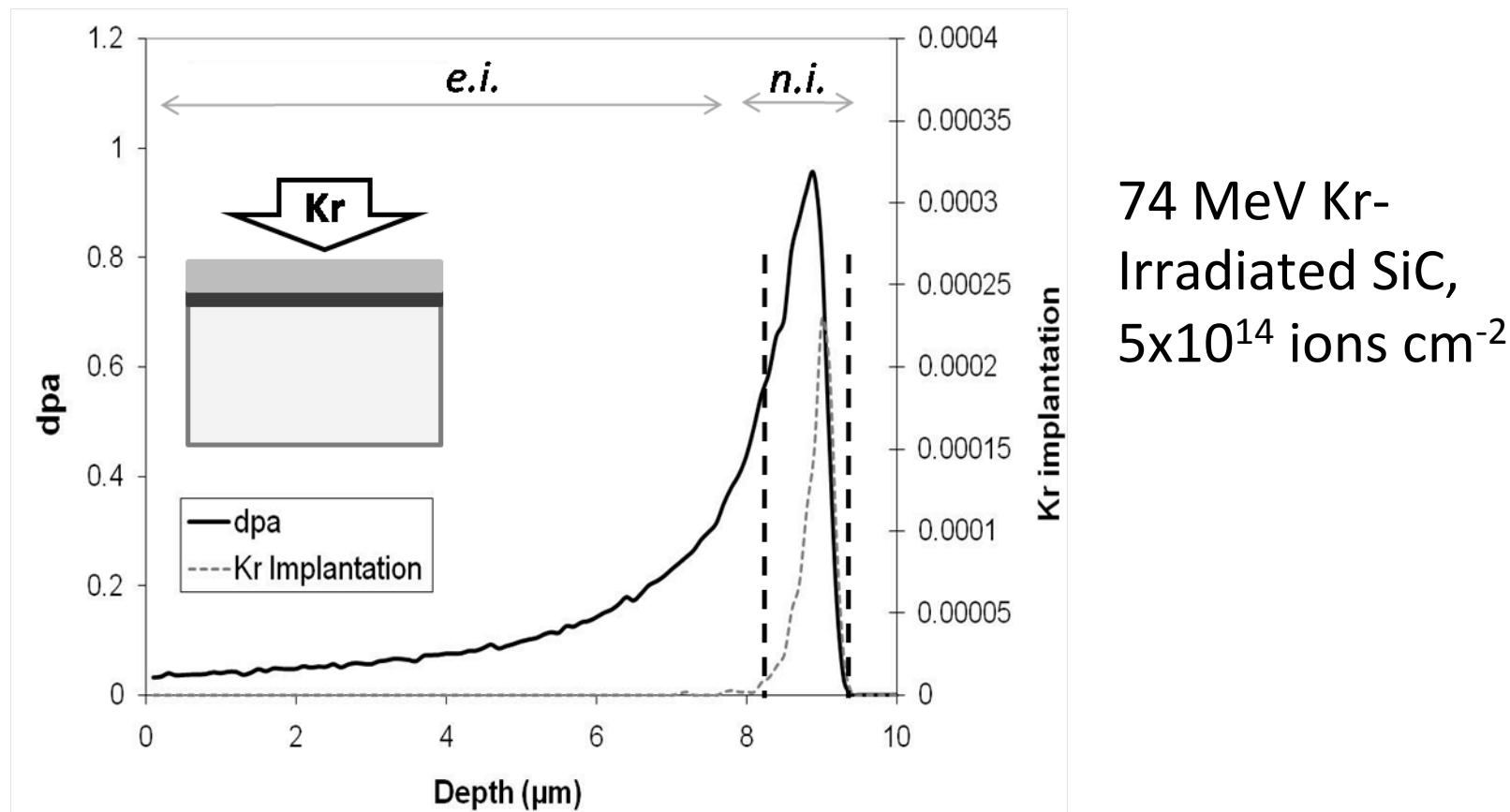
Légère diffusion du Pt dans la couche de GST lorsque la température augmente

Conductivité thermique en fonction de la température

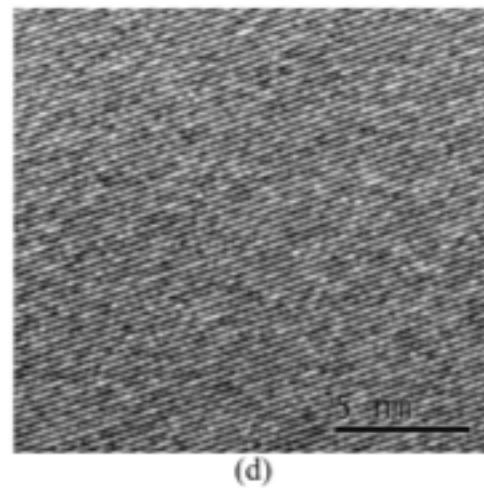
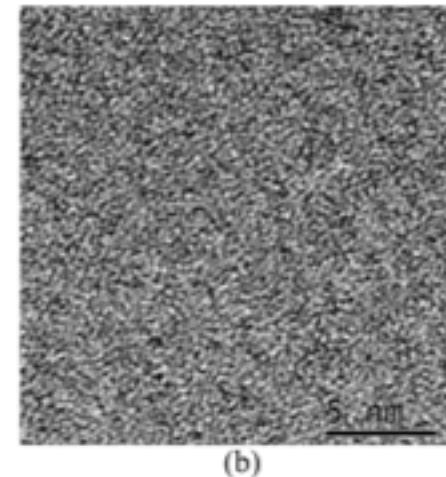
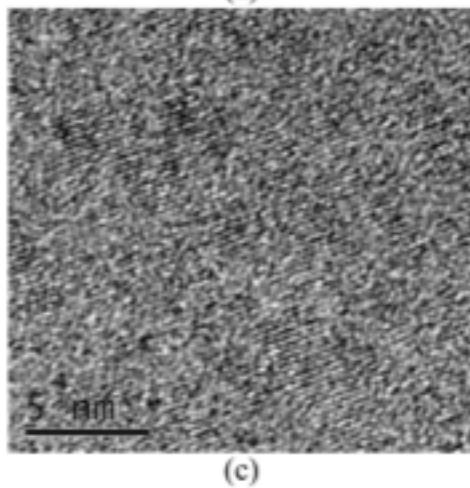
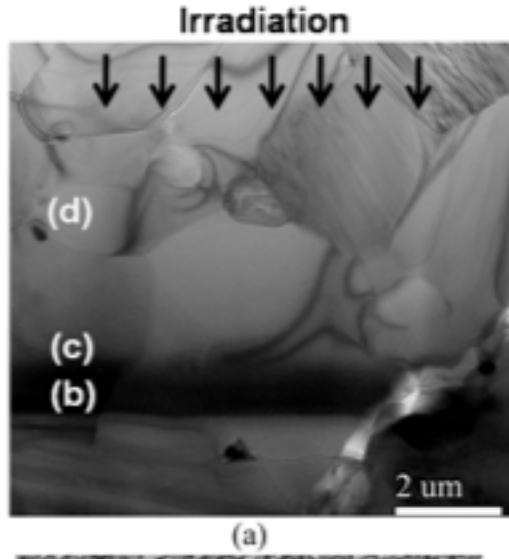


Conductivité de SiC irradié

J. Cabrero, F. Audubert, R. Pailler, A. Kusiak, J.L. Battaglia, P. Weisbecker, *Thermal conductivity of SiC after heavy ions irradiation*, J. Nuc. Mat. **396**, 202–207 (2010).

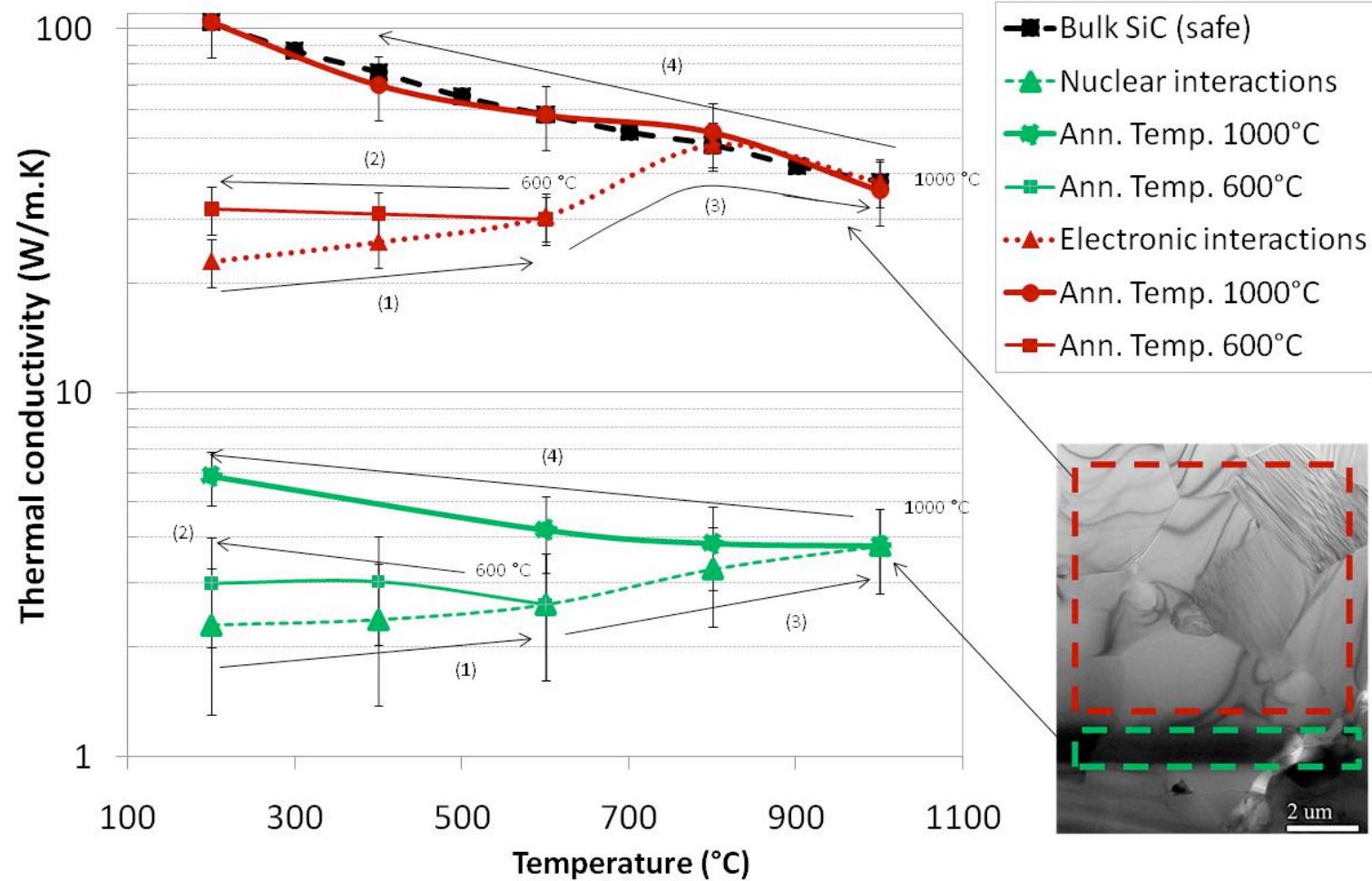


Structure cristalline du matériau irradié



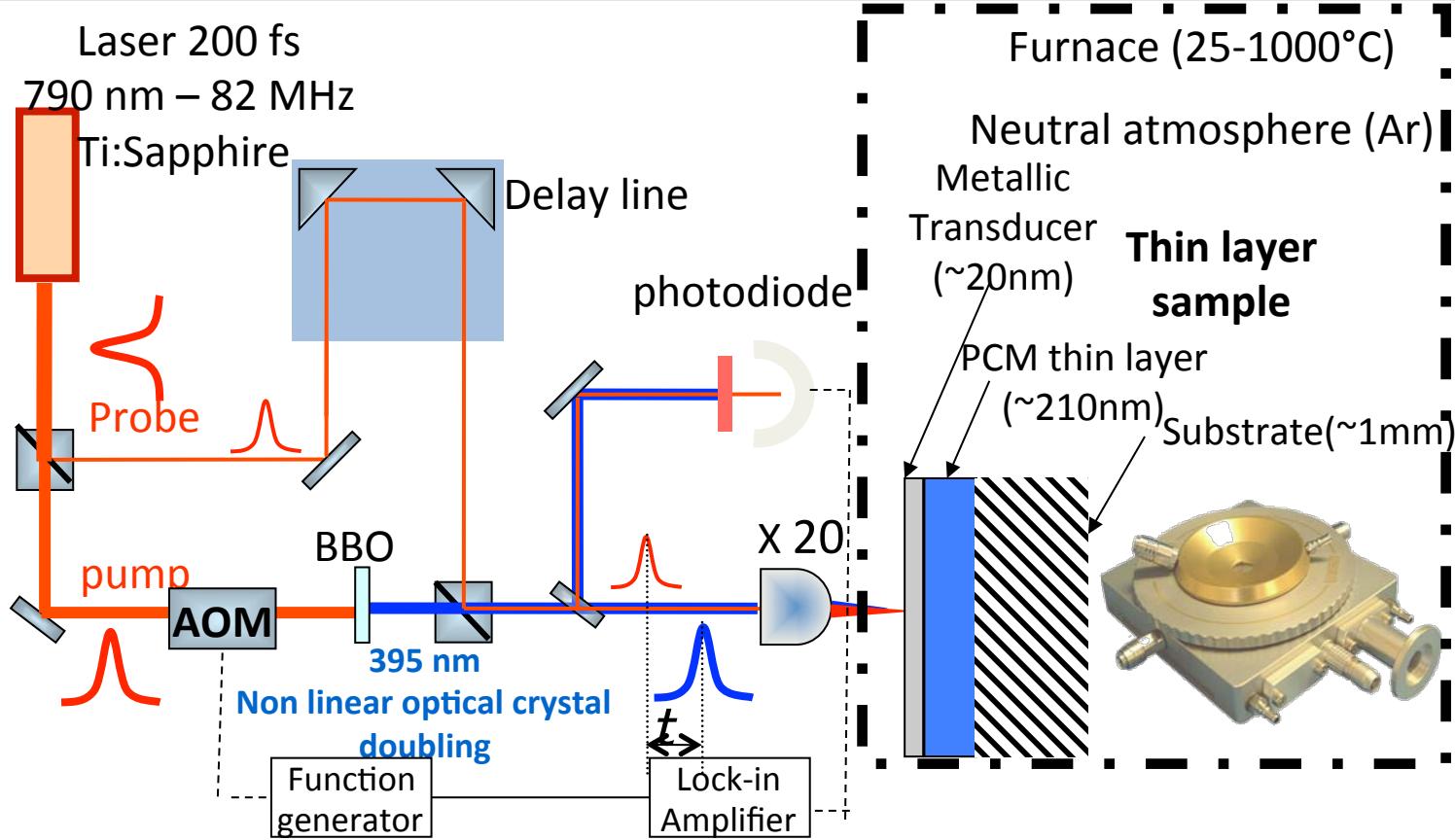
- (a) Implanted layer
- (b) Amorphous layer
- (c) Limit electronic interactions / nuclear interactions domain
- (d) Electronic interactions domain.

Mesure de conductivité thermique jusqu'à 1000°C par MPTR



Mesures des propriétés thermiques de couches mince par thermo-réflectométrie psec

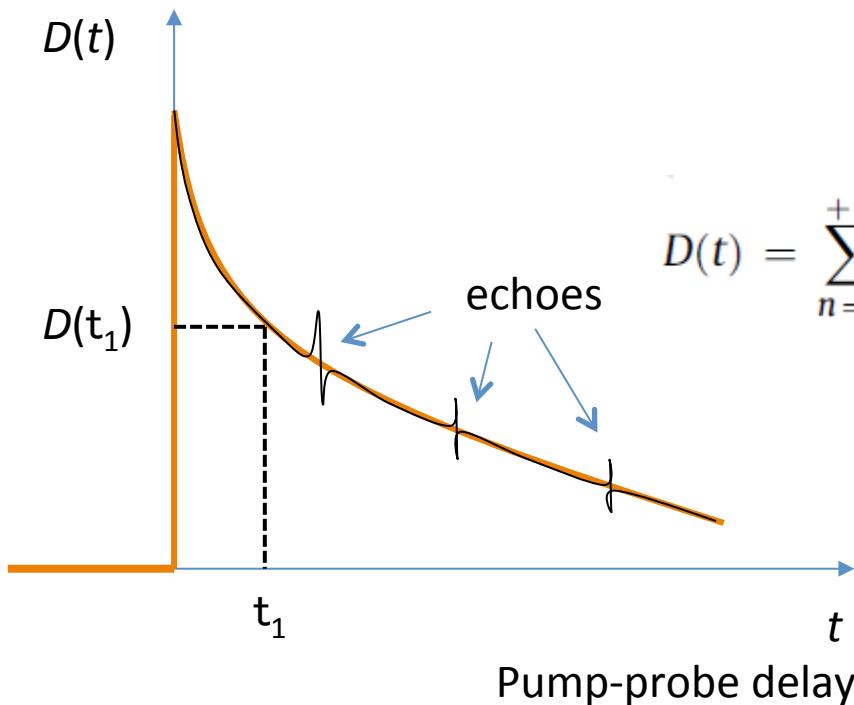
J.-L. Battaglia, V. Schick, C. Rossignol, A. Kusiak, I. Aubert and C. Wiemer, *Thermal resistance at Al-Ge₂Sb₂Te₃ interface*, Appl. Phys. Lett. **102**, 181907, 2013;



Caractérisation d'un interface métal-semi-conducteur jusqu'à 400°C

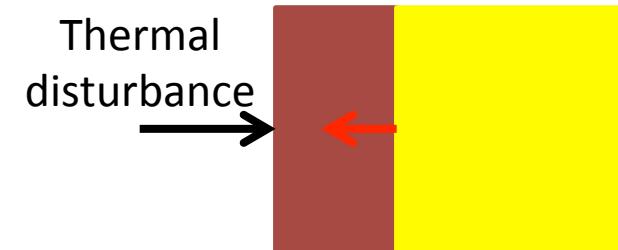
- Métal : Or, Al (bonne variation relative de réflectivité en fonction de la température)
- Bonne propagation des ondes acoustiques
- Basse température de fusion
- Bonne diffusion des espèces chimiques en fonction de la température

Signal mesuré



$$D(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} h(t + n\tau) \exp(-j2\pi f_m(t + n\tau))$$

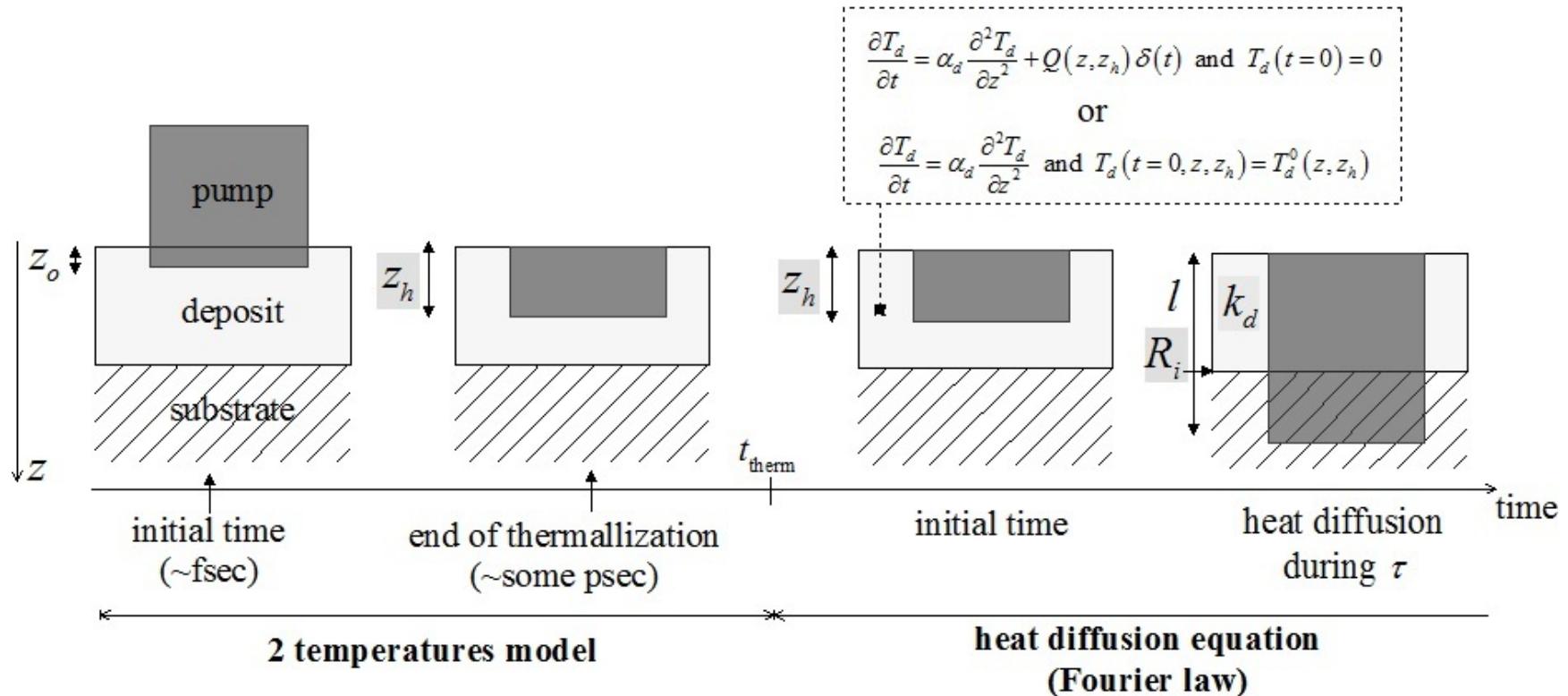
↑
Impulse response



Repeating the experiment for several delay time

Acoustic
wave
reflection

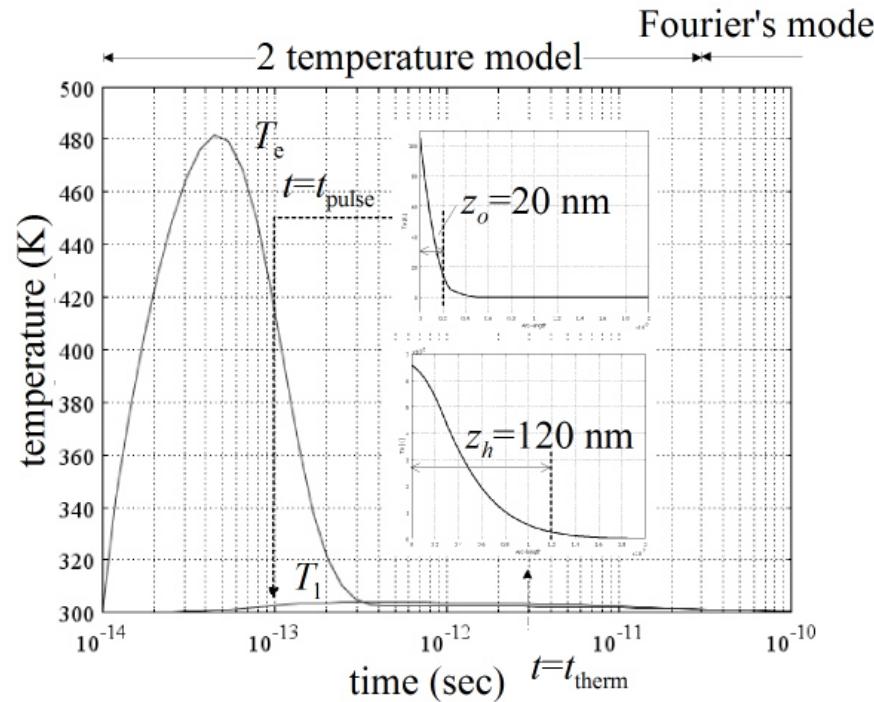
Modèle



Modèle « temps courts »

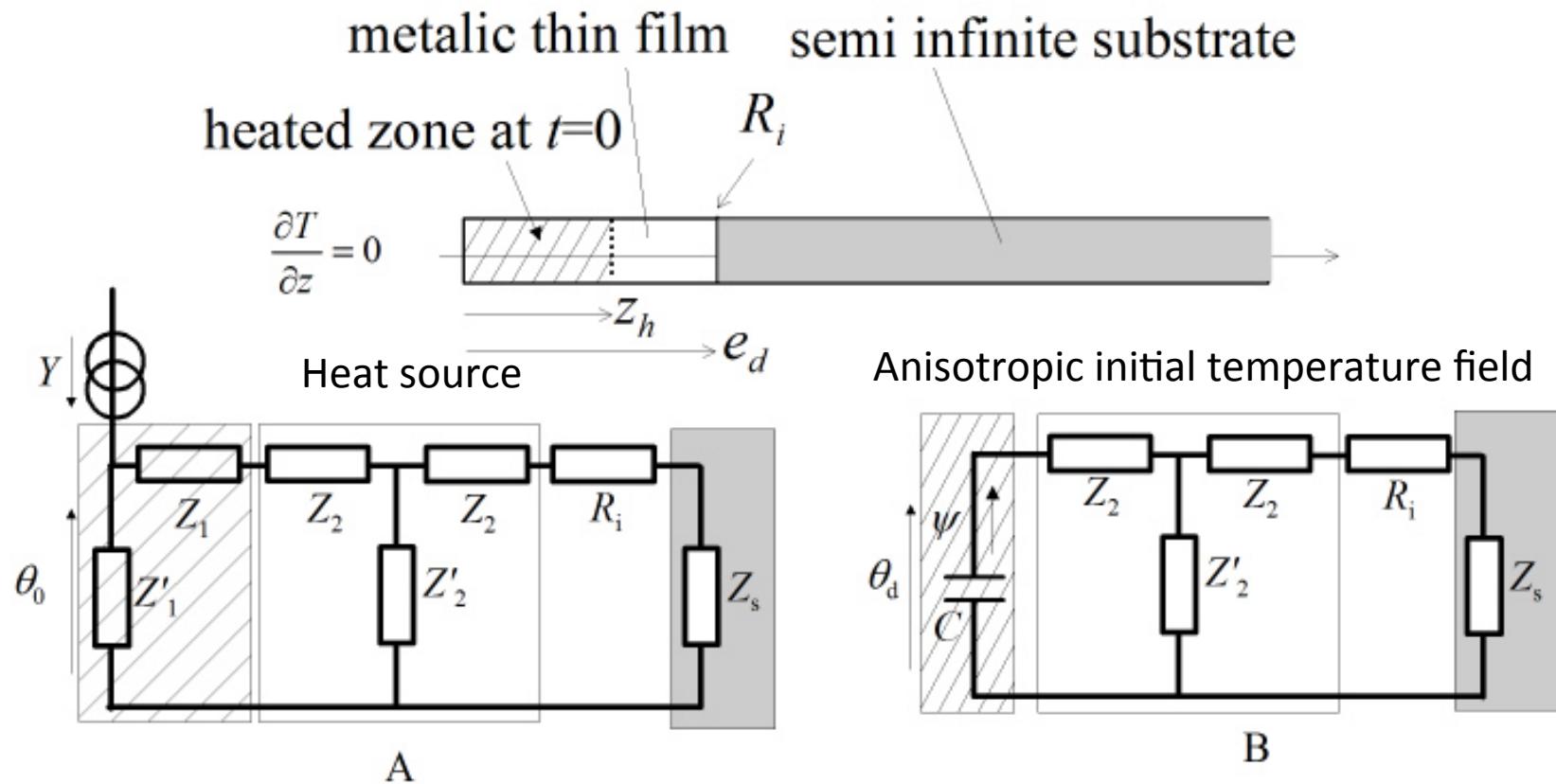
P. H. A. Nobrega, H. R. B. Orlande, J.-L. Battaglia, *Bayesian estimation of thermophysical parameters of thin metal films heated by fast laser pulses*, Int. Comm. In Heat and Mass Transfer **38**, 9, 1172-1177 (2011).

$$\begin{cases} C_e(T_e) \frac{\partial T_e}{\partial t} = \nabla \cdot (k_e(T_e, T_l) \nabla_{r,z} T_e) - G(T_e - T_l) + S \\ C_l \frac{\partial T_l}{\partial t} = G(T_e - T_l) \end{cases} \quad S = \frac{T_\lambda}{\pi z_0 r_h^2} e^{-z/z_0} e^{-(r/r_h)^2} I_0 f(t)$$



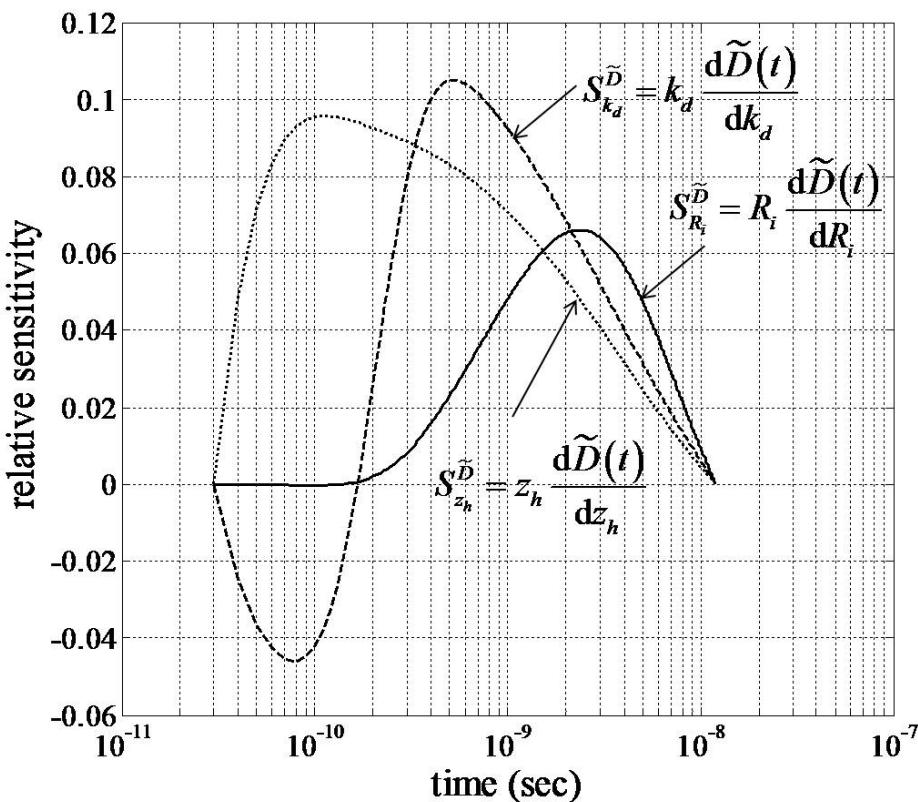
Modèle « temps longs »

J. Pailhes, C. Pradere, J.-L. Battaglia, J. Toutain, A. Kusiak, A.W. Aregba, J.C. Batsale, *Improvement of the thermal quadrupole method for multilayered media with heat sources*, J. Thermal Sciences **53**, 49–55 (2012).



Sensibilité aux propriétés recherchées

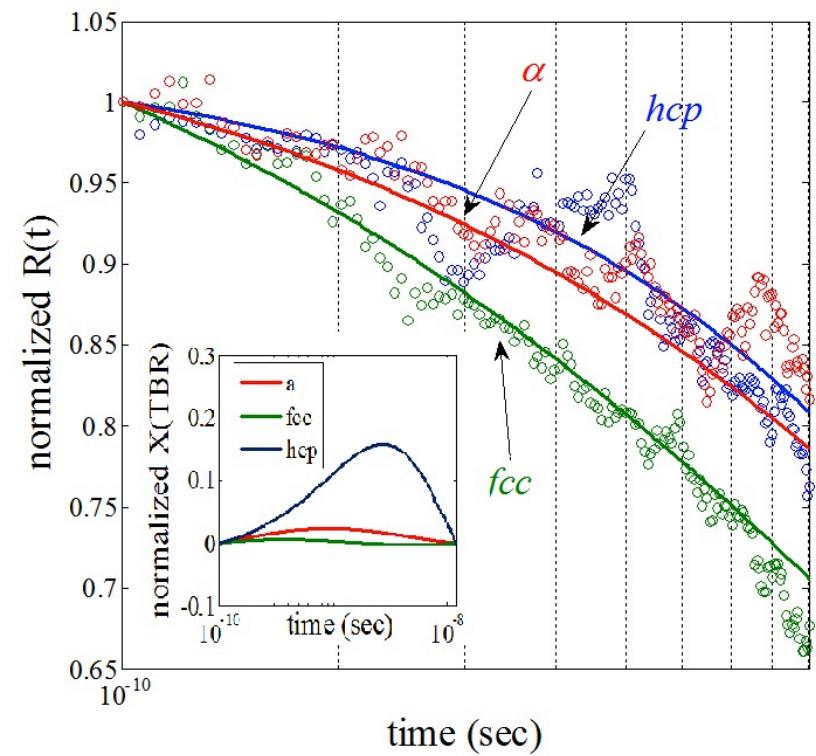
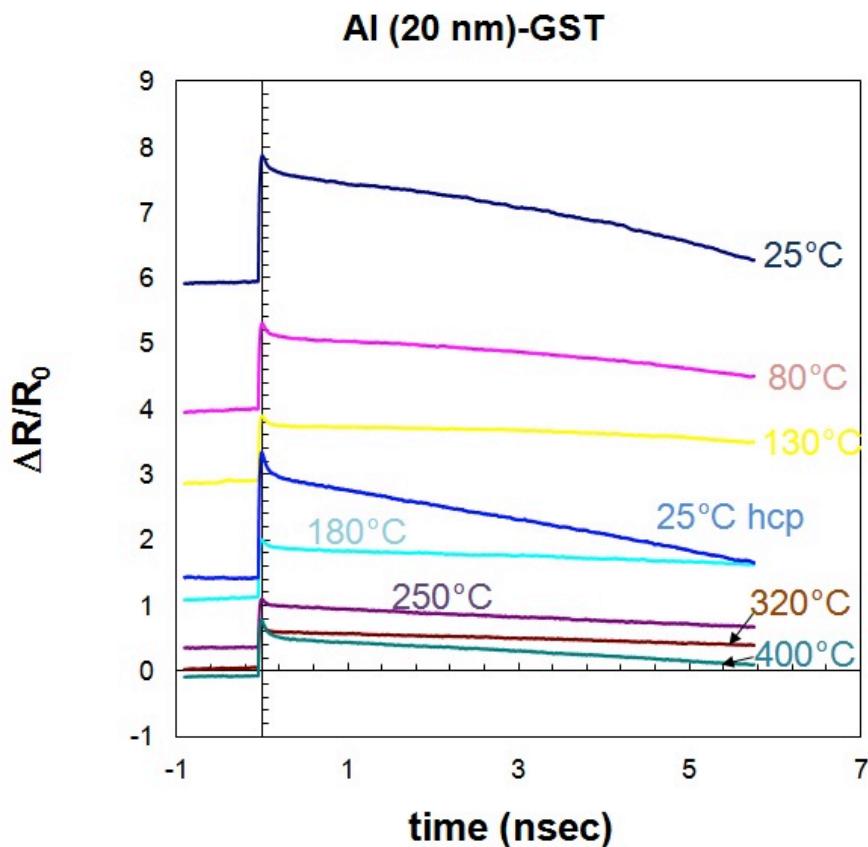
J.-L. Battaglia, V. Schick, C. Rossignol, O. Fudym, P. H. A. Nobrega, H. R. B. Orlande
Global estimation of thermal parameters from a picoseconds thermoreflectometry experiment, Int. J. Thermal Sciences **57**, 17-24 (2012).



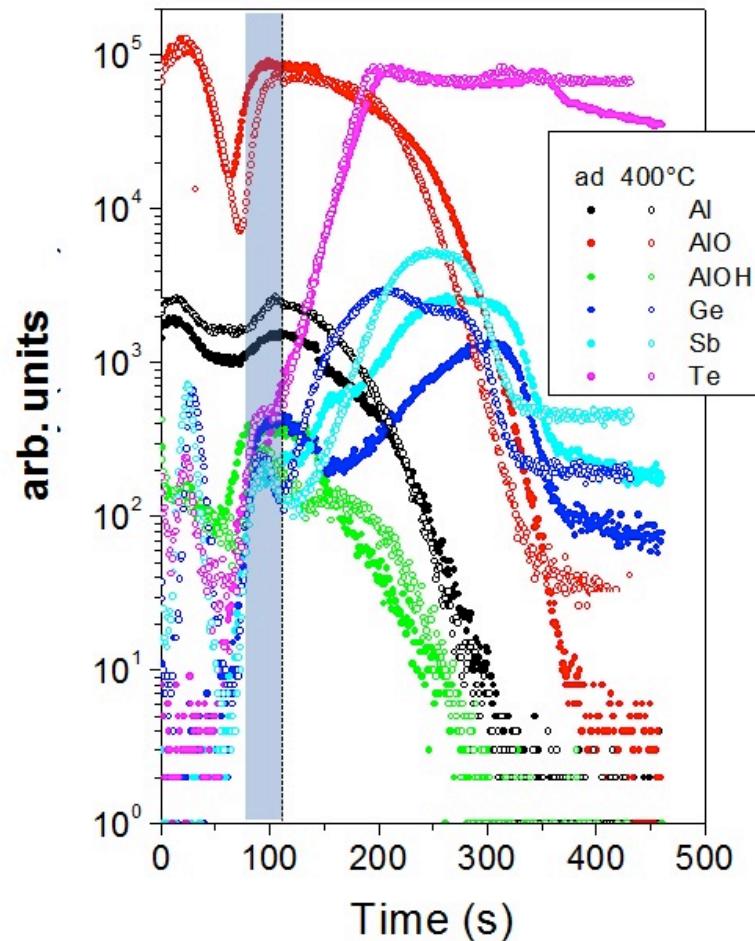
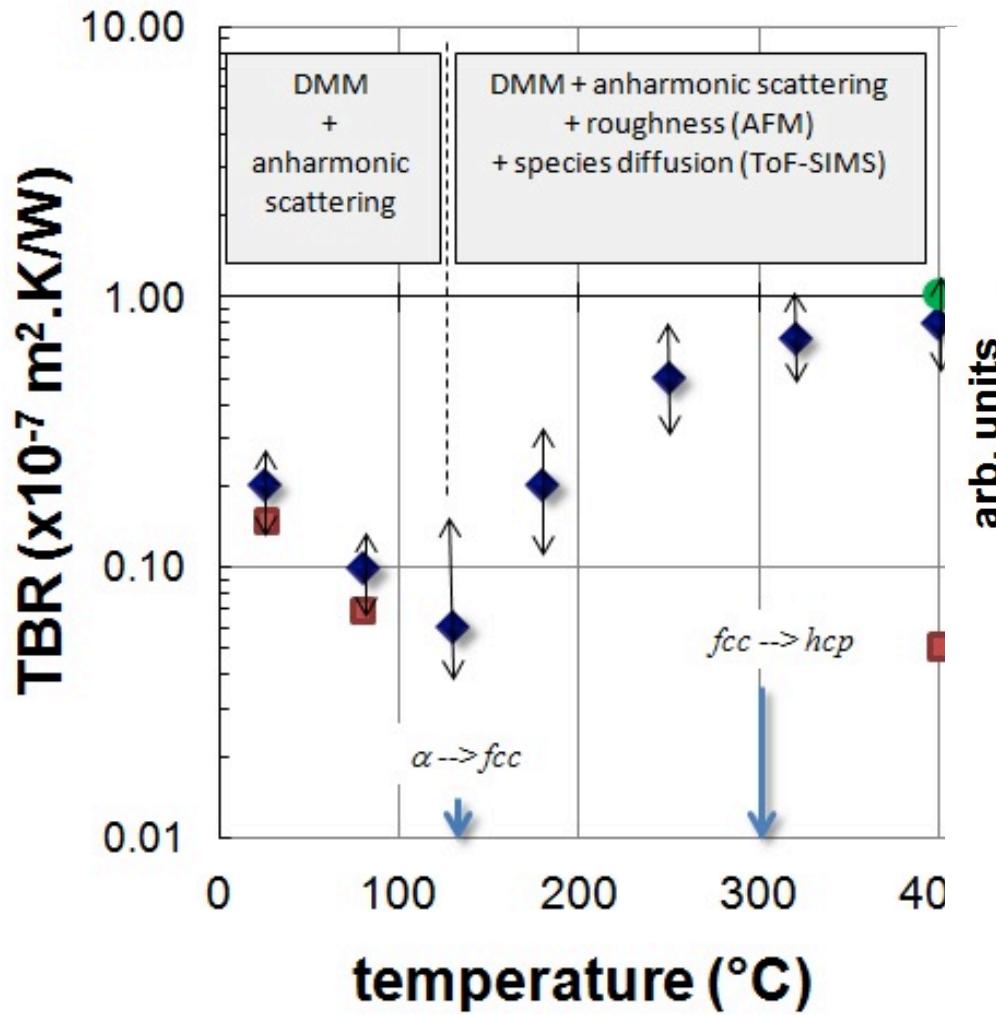
Goal : estimate k_d , R_i and z_h for a metal-Si substrate sample

Les fonctions de sensibilité ne sont pas corrélées partout
Une technique d'estimation Bayésienne est bien appropriée.

Résultat des mesures

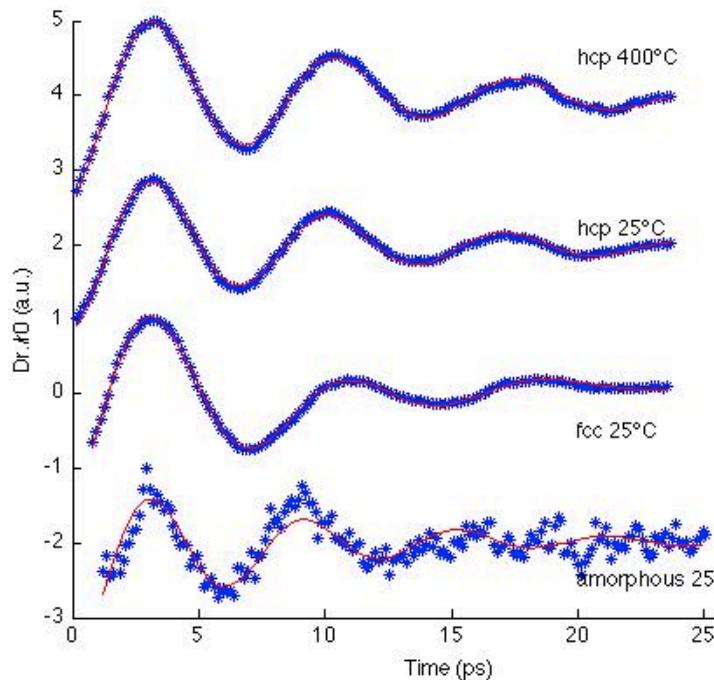


Extraction de la résistance d'interface



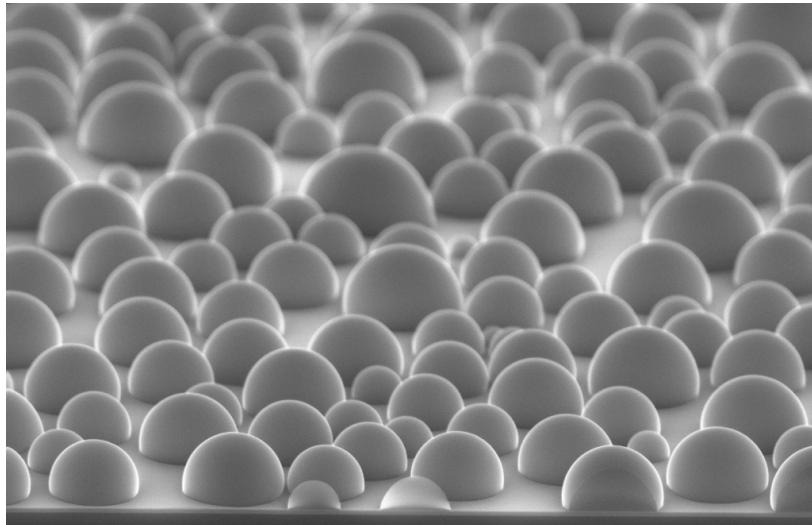
Lien avec la mesure de raideur à l'interface

$$R_{ph-ph} = 4 / (\tau_{GST-Al} C_{p,GST}(T) v_{GST})$$

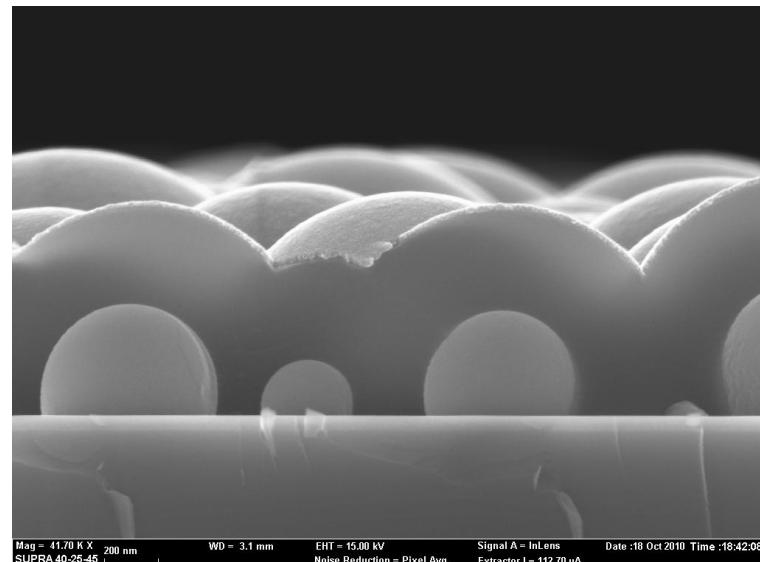


	Al-GST $_\alpha$	Al-GST $_{fcc}$	Al-GST $_{hcp}$
Measured TBR [m ² .K.W ⁻¹]	$2 \pm 0.5 \times 10^{-8}$	$6 \pm 2 \times 10^{-9}$	$8 \pm 2 \times 10^{-8}$
τ_{Al-GST} (Theory, DOS)	0.865	0.73	0.73
R_{ph-ph} [m ² .K.W ⁻¹] (High T model)	1.423×10^{-8}	5.647×10^{-9}	5.189×10^{-9}
R_a (nm), on GST / Al (± 0.1 nm)	0.4 / 0.7	0.5 / 0.8	0.7 / 0.9
μ_{exp}	0.31 ± 0.01	0.15 ± 0.01	0.11 ± 0.01
f_{exp} (GHz)	165 ± 20	130 ± 10	145 ± 10
R_{ac}^{exp}	0.15 ± 0.05	0.3 ± 0.05	0.45 ± 0.05
τ_{Al-GST}^{exp} (ACO)	0.69	0.52	0.29
k_r [GPa.nm ⁻¹]	75 ± 5	25 ± 3	15 ± 3

Mesures des propriétés thermiques de couches minces en phase solide et liquide



Mag = 50.00 K X 1 μm WD = 3.4 mm EHT = 15.00 kV
SUPRA 40-25-45 Noise Reduction = Pixel Avg. Signal A = InLens Date :15 Feb 2010 Time :18:35:02
Extractor I = 105.70 pA

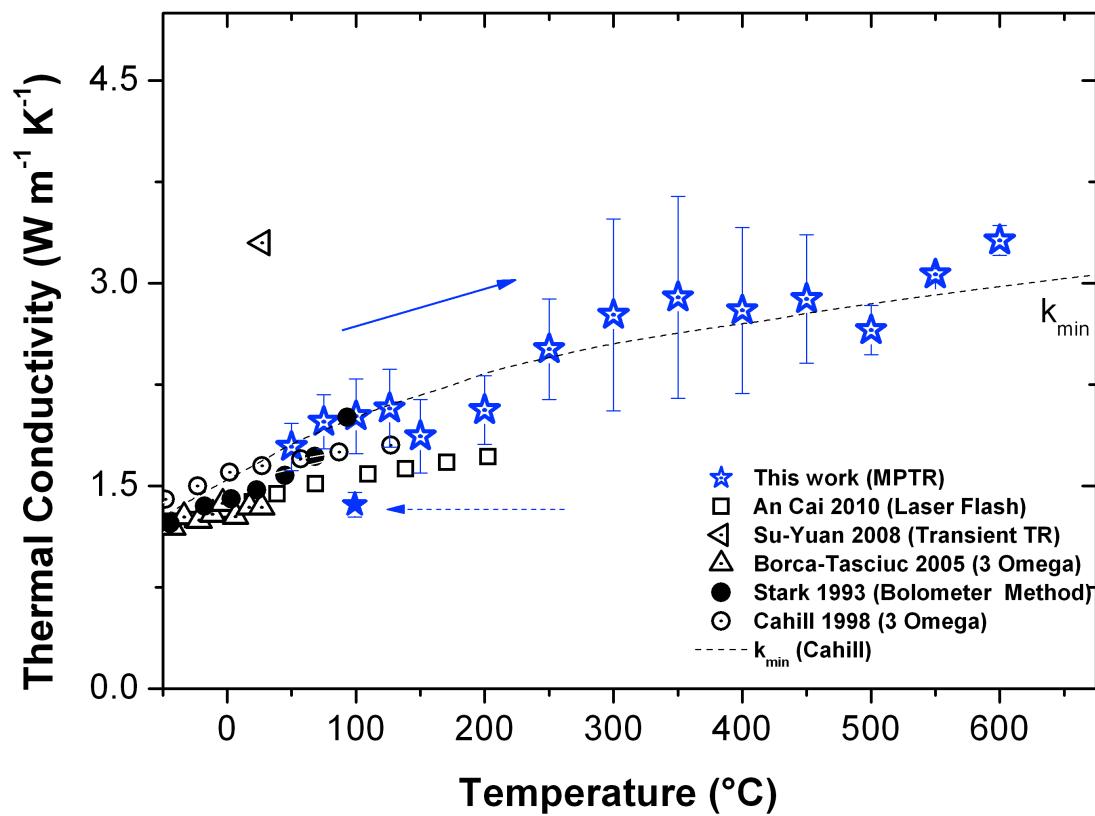


Mag = 41.70 K X 200 nm WD = 3.1 mm EHT = 15.00 kV
SUPRA 40-25-45 Noise Reduction = Pixel Avg. Signal A = InLens Date :18 Oct 2010 Time :18:42:08
Extractor I = 112.70 pA

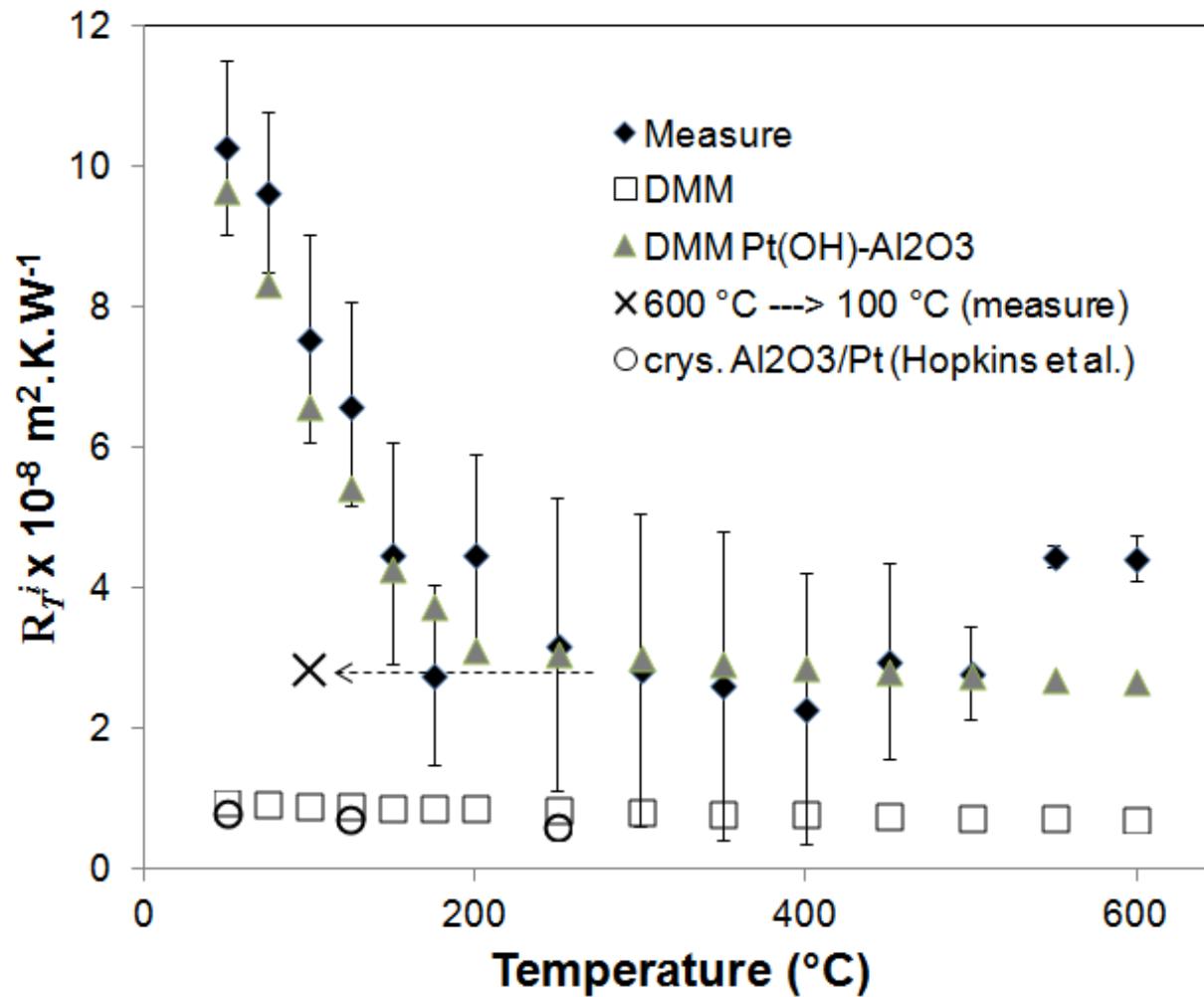
« Boulles » de Te recouvertes par Al₂O₃ et d'un transducteur optique en Pt

Conductivité de la couche d' Al_2O_3 déposée par ALD

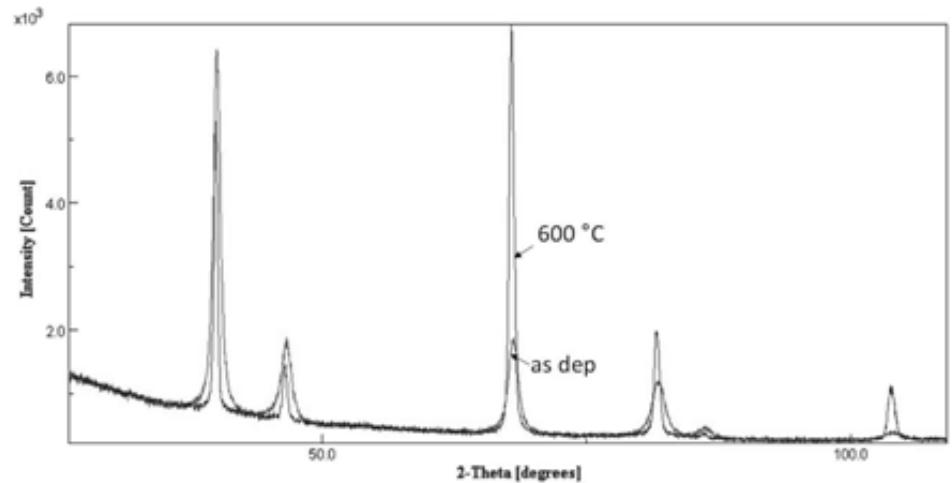
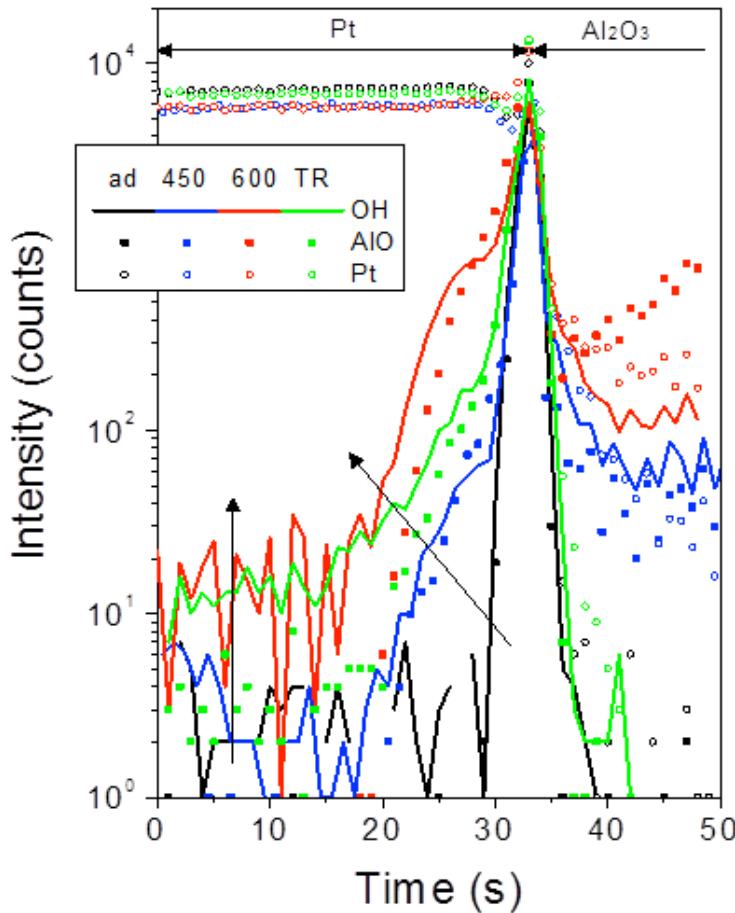
A. Cappella, J.-L. Battaglia, V. Schick, A. Kusiak, C. Wiemer and B. Hay, *High temperature thermal conductivity of amorphous Al_2O_3 thin films grown by low temperature ALD*, Advanced Engineering Materials, DOI: 10.1002/adem.201300132, 2013.



Résistance à l'interface entre Pt et Al₂O₃



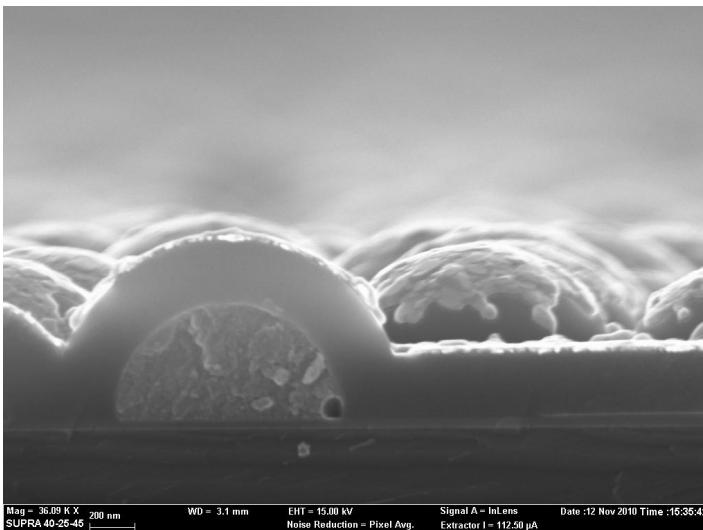
Caractérisation physico-chimique



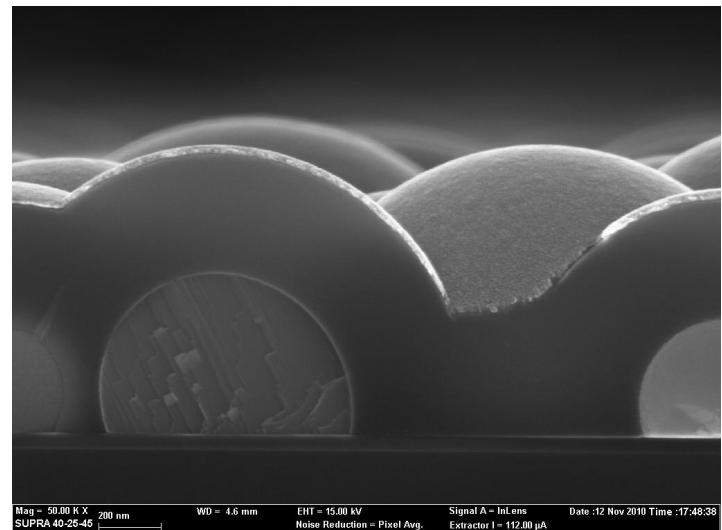
L' Al_2O_3 reste amorphe à haute température

Influence de l'épaisseur d' Al_2O_3

recuit 450°C / 20 min
300 nm Al_2O_3



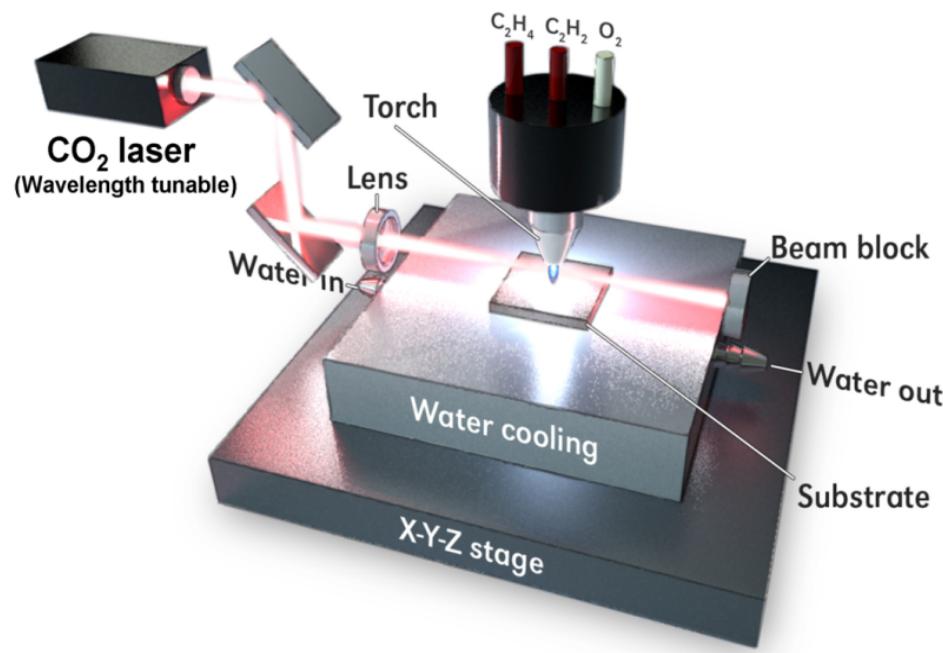
recuit 450°C / 20 min
400 nm Al_2O_3



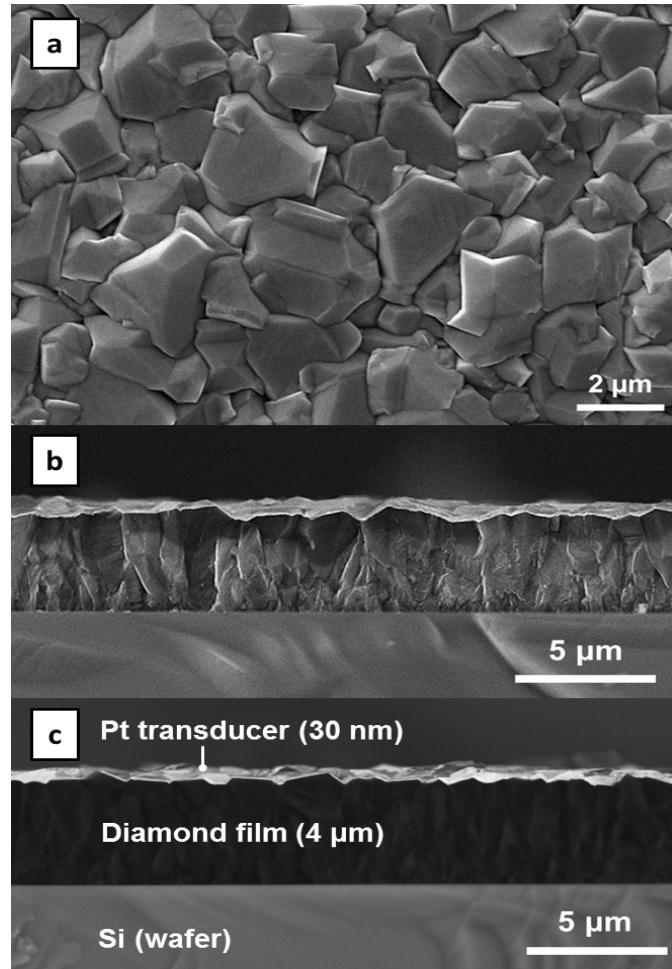
Malheureusement pas encore de résultats exploitables après 350°C...

Mesure de la conductivité thermique de films de diamant déposés par plasma assisté par laser

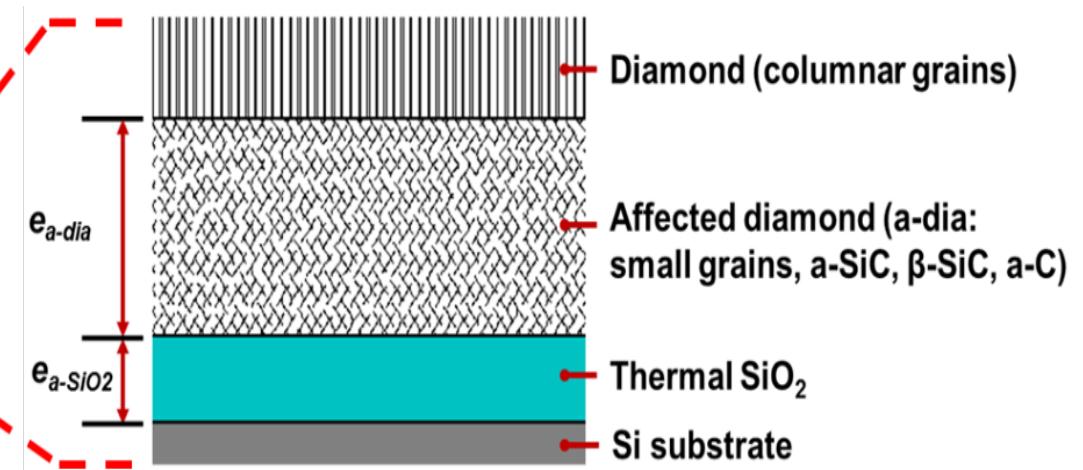
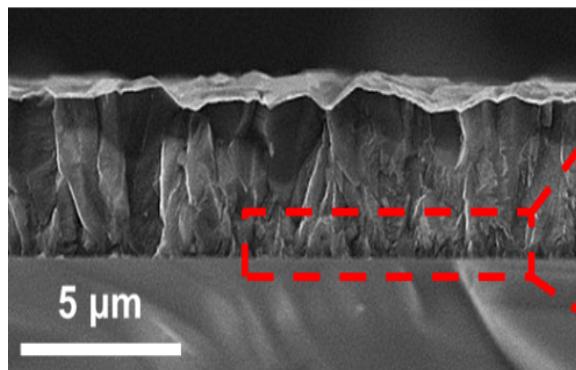
- T. Guillemet, A. Kusiak, L. Fan, J.-M. Heintz, N. Chandra, Y. Zhou, J.-F. Silvain, Y. Lu, and J.-L. Battaglia, *Thermal characterization of diamond films through modulated photothermal radiometry*, accepted in Journal Applied Physics.



Mesure de la conductivité thermique de films de diamant déposés par plasma assisté par laser



Mesure de la conductivité thermique de films de diamant déposés par plasma assisté par laser

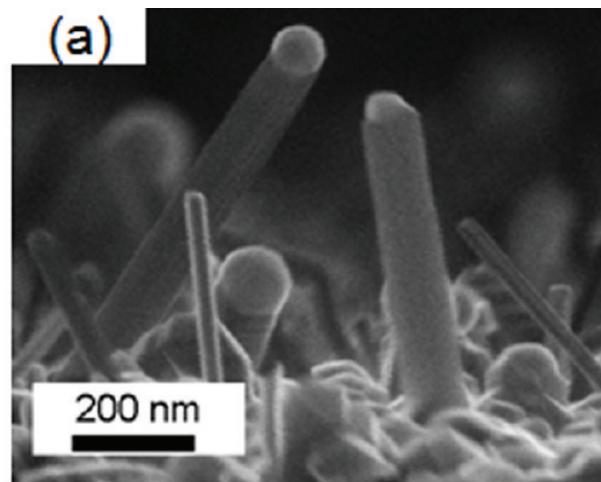


Mesure de la conductivité thermique de films de diamant déposés par plasma assisté par laser

e_{Dia} (μm)	5	10	12.5	15
R_a (nm)	210	380	420	450
$R_{Pt/Dia}$ ($\times 10^{-7}$ K.m 2 .W $^{-1}$)	0.51	0.91	0.97	1.10
$R_{Dia/Si}$ ($\times 10^{-7}$ K.m 2 .W $^{-1}$)	3.69	3.09	1.72	1.71
k_{a-Dia} (W.m $^{-1}$.K $^{-1}$)	1.023	1.286	3.117	3.150

Mesures des propriétés thermiques de GST et IST sous forme de nanofils.

- Projet Européen SYNAPSE



(MOCVD 400°C, 50 mbar)

